

Doc.No : NR040212

2004年2月12日

## アメリカ・ナノメトリクス社と塗布現像装置に関して業務提携

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区)の半導体機器カンパニー(社長：末武 隆成)はこのほど、アメリカの大手計測装置メーカー、Nanometrics社(以下、ナノメトリクス社/本社：アメリカ・カリフォルニア州/CEO：ジョン・D・ヒートン氏)と塗布現像装置に関する業務提携を締結。当社の300ミリウエハー対応の塗布現像装置「RF<sup>3</sup>(アール・エフ・キューブ)」にオプションとして、同社の計測装置を搭載することで合意しました。

半導体業界では現在、回路パターンの線幅が90ナノメートル(ナノは十億分の一)の超高集積デバイスの量産化が開始されようとしているほか、2007年には65ナノメートルにまで微細化されると予測されています。これら超微細な半導体デバイス製造では、回路パターンをシリコンウエハー上に焼き付けるフォトリソグラフィ工程における線幅精度は品質を大きく左右する要因です。また、生産効率の向上を目指したウエハーの大口径化や高集積化に対応するため、形成されたレジストの膜厚や線幅の測定結果を塗布現像装置に即座にフィードバックできる計測システムが求められています。

大日本スクリーンでは、市場で多くの顧客に求められている計測装置を「RF<sup>3</sup>」に搭載できるよう、計測装置メーカーに対してインライン化の仕様を公開しており、高い信頼性を持つ搭載型の計測装置を提案することで、より最適な生産環境の提供を目指します。

ナノメトリクス社は、計測装置市場で高い技術力と実績を持っており、今回オプションとする装置は、レジストの膜厚などを測定することで処理精度の高い品質の安定性を保持する次世代の制御システム、APC(アドバンスド・プロセス・コントロール)の実現にも不可欠な装置です。

今回の業務提携では、「RF<sup>3</sup>」および計測装置の販売、メンテナンスは両社がそれぞれ単独で行います。

### ■ナノメトリクス社

アメリカ・カリフォルニア州ミルピタスに本社を置く計測装置のリーディングカンパニー。半導体製造、フラットパネル製造、磁気ヘッド製造などの分野で活用される計測装置を数多く製造、販売し、市場から高い評価を得ている。ナスダック市場に株式を上場。

HP:<http://www.nanometrics.com/>